(19) 日本国特許庁 (JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭57-143844

(5) Int. Cl.³ H 01 L 21/78 識別記号

庁内整理番号 7131-5F ④公開 昭和57年(1982)9月6日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

64ウエハのチップ構造

昭256—28857

②出 願 昭56(1981) 2 月28日

70発 明 者 寺澤富三

門真市大字門真1048番地松下電

工株式会社内

⑪出 願 人 松下電工株式会社

門真市大字門真1048番地

邳代 理 人 弁理士 石田長七

明 細 書

1. 発明の名称

21)特

ウェハのチップ構造

2 特許請求の重選

(1) 円柱状の棒体をその軸方向と直交方向にスライスして半導体の不純物を含んだ円板状のウェハを形成し、このウェハを多数分割してトランジスタや集積回路が形成されるチップの形状を六角形に形成して成るウェハのチップ構造。

3 発明の詳細な説明

本発明は大規模集積回路や集積回路に使用されるウェハのチップ構造に関するものである。

従来例を第1図及び第2図に示す。図中(1)は円柱状の棒体で、この棒体(1)をその軸方向と直交する方向に輝くスライスして半導体の不統物を含んだシリコンをペースとする円板状のウェハ(2)を形成する。更にこのウェハ(2)を多数分割してトランジスタ、集積回路及び大規模集積回路が形成されるチップ(2)を形成している。例えば大規模集積回路(

以下LSIという)のチップi3/を形成する場合に、 第2 図に示すように直径3 インチの1枚のウェハ(2)から5 畑角のチップi3/が 150 涸渓れる。しかしながら、LSIチップi3/を四角形に形成カットしていたため円形のウェハ(2)の陶線の部分(第1 図に示す消線部)はチップi3/として使用できない面積が多いという問題があつた。またウェハ(2)の 端部ぎりぎりの部分ではシリコンの不納物量が内部と異なるので、 満部ぎりぎりのチップi3/とではチップi3/間の特性はらつきが出るという問題があつた。

本発明は上述の点に遊みて提供したものであつて、ウェハ上に六角形のチップを形成してカットすることにより、同一直便のウェハよりチップ数を多く採ることを目的としたウェハのチップ構造を提供するものである。

以下本発明の実施例を図面により詳述する。同 ウェハ(2)自体の形成までは従来例と同様であるので省略する。即ち乗3回及び乗4回に示すように、四角形で形成した従来のチップ(3)が面積と同一面

特開昭57-143844 (2)

で正六角形のチップ(3)を形成している。そして との正六角形のチップ(3)を多数形成して従来と同 じ直径3インチのウェハ(2)上に形成すると 153個のチ ップ(3)を形成することができる。またウェハ(2)の 間端級に対して従来と比べて比較的に間隔をもた せてチップ(3)を形成することができる。

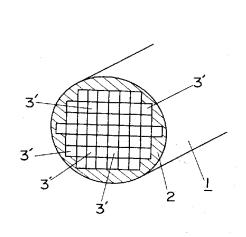
のばらつきも生じることなく歩留りを间上せしめ、しかも、従来と比べて面積が同一であるから集 機度も減少しない効果を突する。

4 図面の簡単な説明

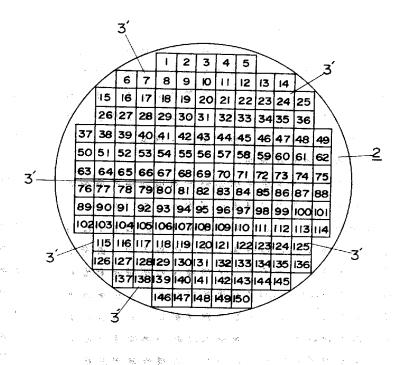
第1図は従来例の科視図、第2図は同上のウェハの拡大正面図、第3図は本発明の実施例の料視図、第4図は同上のウェハの拡大正面図で、il)は僅体、(2)はウェハ、i3)はチップである。

代理人 弁理士 石 田 長 七

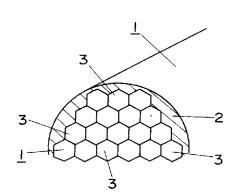
第2 図

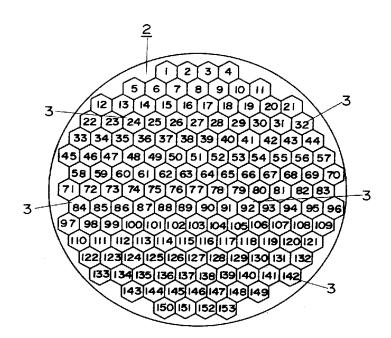


第 | 図



第3図





PAT-NO: JP357143844A

DOCUMENT- JP 57143844 A

IDENTIFIER:

TITLE: CHIP COMPOSITION OF

WAFER

PUBN-DATE: September 6, 1982

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TERASAWA, TOMIZO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD N/A

APPL-NO: JP56028857

APPL-DATE: February 28, 1981

INT-CL (IPC): H01L021/78

US-CL-CURRENT: 257/E21.599, 438/464

ABSTRACT:

PURPOSE: To take more chips out of a wafer of an identical area and improve the yield by a method wherein hexagonal chips

are formed on the wafer and are cut out.

CONSTITUTION: A disc wafer 2 is sliced out of a cylindrical semiconductor single crystal substance 1. The wafer is divided into hexagonal semiconductor chips 3 in which integrated circuits or like are composed. The impurity density in the circumference area of the substance 1 is differnt from that in the inner area, but the chips obtained by dividing the wafer into hexagons can be arranged in the circumference area at the relatively uniform intervals, so that the deviation of the impurity density for respective chips can be avoided. And, for instance, 153 hexagonal chips can be cut out of a three-inch wafer, while 150 square chips can be cut out of the same wafer.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio